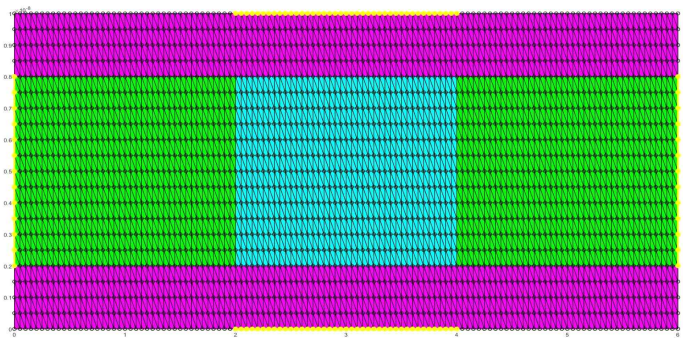


Structure

Double gate MOSFET	region & contact
	<p> 상단 magenta : gate oxide1 하단 magenta : gate oxide2 좌측 green : source region 우측 green : drain region 중앙 blue : silicon region 상단 yellow line : gate contact1 하단 yellow line : gate contact2 좌측 yellow line : source contact 우측 yellow line : drain contact </p>
<p> gate oxide thickness : 2nm silicon thickness : 6nm source / drain length : 20nm channel length : 20nm total x length : 60nm total y length : 10nm device width : $6\mu m$ </p>	<p> N-type doping : $5E26(/m^3)$ P-type doping : $2E21(/m^3)$ gate workfunction : 4.3eV </p>
	<p> total vertex : 2541 jacobian matrix : 5929 X 5929 residue matrix : 5929 X 1 </p>

(변동사항)

mesh를 좀 더 세밀하게 나누어 구조를 분석했다. 먼저 S/D의 thickness를 6nm로 줄였으며 channel의 길이를 S/D의 length와 같은 20nm로 설정했다. 또한, x mesh와 y mesh 모두 0.5nm로 설정하여 총 vertex의 개수 ($241 \times 21 = 2451$)로 설정하였으며, jacobian matrix의 size는 5929×5929 이다.

(과제 설명)

이번 과제는 이전의 quasi static approximation을 가정했던 시뮬레이션과는 달리 시간의 변화에 대한 current density의 변화를 고려한 transient simulation을 제작하는 것이다. time term을 고려하면 current density 식은 다음과 같이 나타낼 수 있다.

Time term

$$\frac{dn}{dt} = \frac{1}{q} \nabla \cdot J_n \rightarrow \oint J_n \cdot dS = q \iiint_{\Omega} \frac{dn}{dt} dV$$

$$\frac{dp}{dt} = -\frac{1}{q} \nabla \cdot J_p \rightarrow \oint J_p \cdot dS = -q \iiint_{\Omega} \frac{dp}{dt} dV$$

1) electron case

$$\frac{dn}{dt} = \frac{1}{q} \nabla \cdot J_n \rightarrow -q \frac{dn}{dt} + \nabla \cdot J_n = 0$$

$res(n) = -q \frac{dn}{dt} + \nabla \cdot J_n$ 이므로 이를 residue 항과 jacobian의 항으로 나타내면 다음과 같다.

$$res(n) = -q \times 0.25 \times \frac{n(t) - n(t-1)}{\Delta t} \times length \times edge$$

$$jac(n) = -q \times 0.25 / \Delta t \times length \times edge$$

$n(t-1)$ 은 t-1의 old electron을 저장한 값이므로 constant한 값이기에 jacobian matrix에서는 고려해주지 않는다.

2) hole case

$$\frac{dp}{dt} = -\frac{1}{q} \nabla \cdot J_p \rightarrow q \frac{dp}{dt} + \nabla \cdot J_p = 0$$

$res(p) = q \frac{dp}{dt} + \nabla \cdot J_p$ 이므로 이를 residue 항과 jacobian의 항으로 나타내면 다음과 같다.

$$res(p) = q \times 0.25 \times \frac{p(t) - p(t-1)}{\Delta t} \times length \times edge$$

$$jac(n) = -q \times 0.25 / \Delta t \times length \times edge$$

동일하게 $p(t-1)$ 은 t-1의 old hole을 저장한 값이므로 constant한 값이기에 jacobian matrix에서는 고려해주지 않는다.

위의 값들은 추가적으로 고려해준 사항이므로 기존의 jacobian, residue matrix에 더해준다.

Displacement current term

$$J_{dis} = \frac{dD}{dt} = -\epsilon \frac{E - E_{old}}{\Delta t}$$

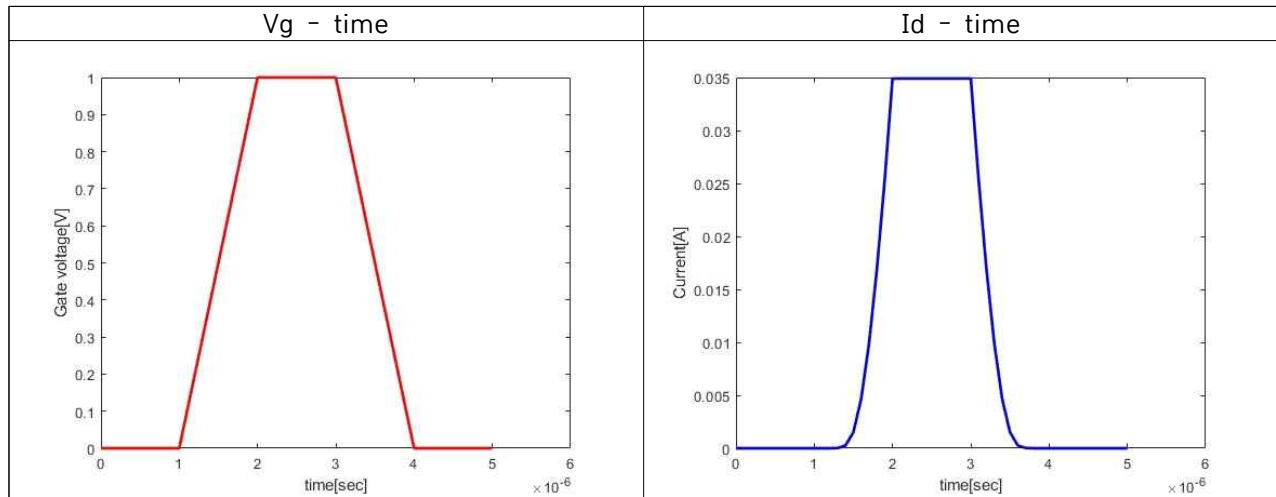
또한, 시간에 대한 potential 변화분을 고려해주어야 하기에 displacement current term을 고려해준다.

$$J_{dis} = \epsilon_{si} \epsilon_0 \left(\frac{\phi(t)_{(element)} - \phi(t)_{(contact)}}{\Delta t} - \frac{\phi(t-1)_{(element)} - \phi(t-1)_{(contact)}}{\Delta t} \right) \times length \times edge$$

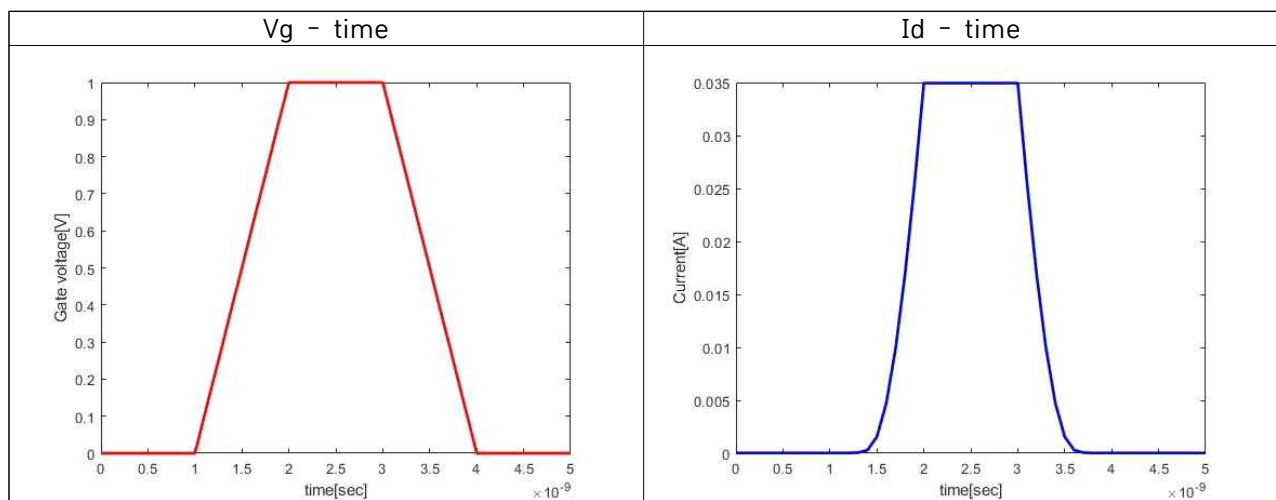
$$I_{dis} = J_{dis} \times W$$

Result

1) $V_d=1V$, time step = $0.1\mu\text{sec}$, rising/falling time = $1\mu\text{sec}$



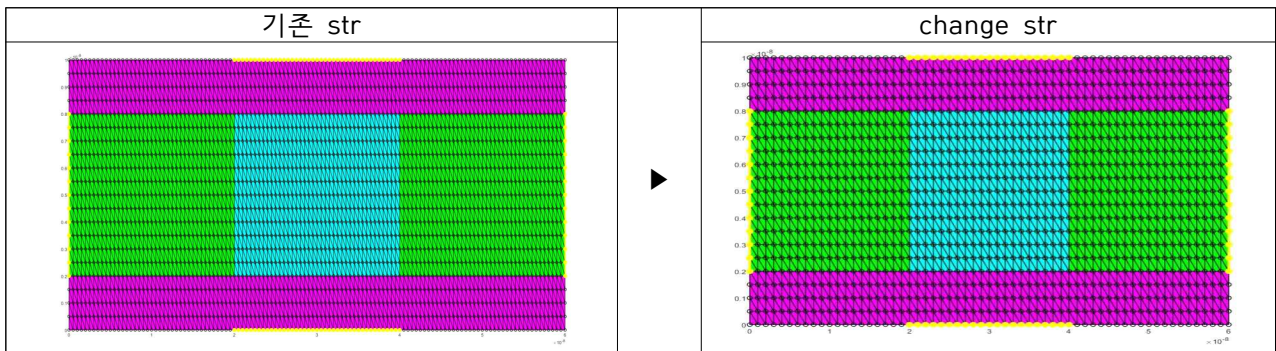
2) $V_d=1V$, time step = 0.1nsec rising/falling time = 1nsec



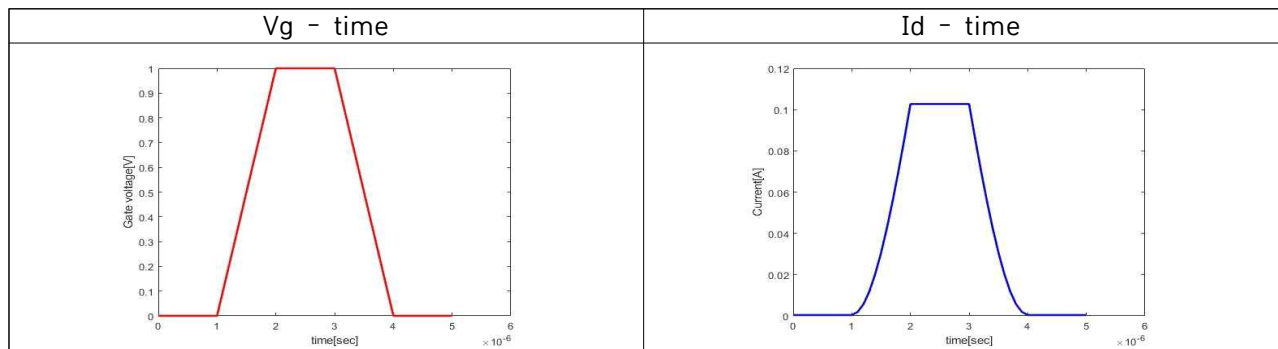
결과 1번은 $V_d=1V$, time step = $0.1\mu\text{sec}$, rising/falling time = $1\mu\text{sec}$, pulse time = $1\mu\text{sec}$ 로 설정하고 time에 대한 Vg, Id graph를 그린 것이다. rising time과 falling time 동안 Vg는 linear 하게 변화하고 Id는 non-linear 하게 변화하는 것을 확인할 수 있었다.

결과 2번은 $V_d=1V$, time step = 0.1nsec , rising/falling time = 1nsec , pulse time = 1nsec 로 설정하고 time에 대한 Vg, Id graph를 그린 것이다. 결과 1번과 동일하게 rising time과 falling time 동안 Vg는 linear 하게 변화하고 Id는 non-linear 하게 변화하는 것을 확인할 수 있었다.

지난 과제에 비해 vertex 수를 4배 이상 늘려 진행해본 결과 시뮬레이션 time이 굉장히 길어졌다. 추가적으로 dx의 크기를 기존의 2배인 1nm로 설정하여, vertex 수를 2배 줄이고 시뮬레이션을 진행해보았다.

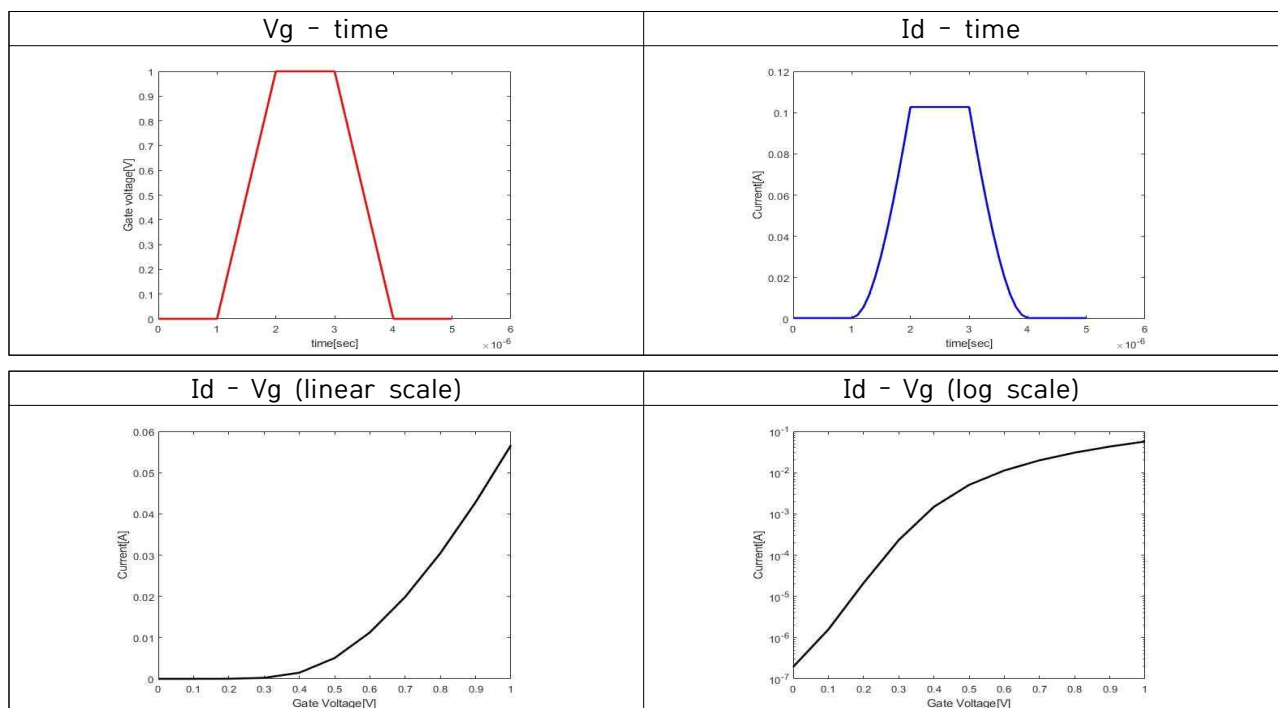


1) $V_d=1V$, time step = $0.1\mu\text{sec}$, rising/falling time = $1\mu\text{sec}$, p-doping = $1E21(/m^3)$



또한, 기존의 graph에서는 V_{TH} 가 정확히 확인되지 않았다. $V_{TH} \propto N_A$ 이기에 N_A 를 증가시켜 V_{TH} 를 확인해보았다.

1) $V_d=1V$, time step = $0.1\mu\text{sec}$, rising/falling time = $1\mu\text{sec}$, p-doping = $1E25(/m^3)$



그래프를 통해 Id는 0.3~0.4V 사이에서 급격히 증가하는 것을 확인할 수 있으며, 이는 V_{TH} 가 해당 구간 내에 존재한다고 유추할 수 있다.